DIALOG(R)File 347:JAPIO
(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03709370 **Image available**

MANUFACTURE OF SOLID-STATE IMAGE SENSING DEVICE

PUB. NO.: 04-074470 **JP 4074470** A] PUBLISHED: March 09, 1992 (19920309)

INVENTOR(s): AOKI HIROMITSU

SANO YOSHIKAZU NOMURA TORU AOKI TADASHI KODAMA KOUTATSU

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRON CORP [000584] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 02-189090 [JP 90189090] FILED: July 16, 1990 (19900716)

INTL CLASS: [5] H01L-027/14; H01L-027/148

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.6

(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive Resins); R098 (ELECTRONIC

MATERIALS -- Charge Transfer Elements, CCD & BBD)

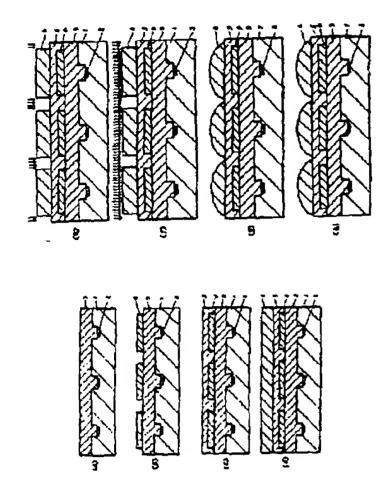
JOURNAL: Section: E, Section No. 1224, Vol. 16, No. 291, Pg. 33, June

26, 1992 (19920626)

ABSTRACT

PURPOSE: To form a micro-lens having high reliability and a large curvature by forming the micro-lens in such a way that a photosensitive resist applied to the entire surface of a transparent resin body is dried by heating at a low temperature and a pattern is treated while the pattern is heated at an intermediate temperature, and then, the formed micro-lens is heat-treated.

CONSTITUTION: The first acrylic flat film 3 of an acrylic resin is formed on the uneven surfaces of a substrate 1 for a CCD solid-state image sensing element and photodiode 2 and a thin-film color filter 4 for separating white light is formed on the film 3. By repeating an applying and drying processes which applies an acrylic resin to the uneven surfaces and dries the resin by heating 2-5 times, the second acrylic flat film 5 which is high in flatness is formed. Then a material 6 for micro-lens is applied by turning to the entire surface of the film 5 to a thickness of >=0.5.mu.m and the material 6 is dried at a low temperature. A desired three-dimensional shape is formed by selectively exposing the material 6 to gamma rays. Thereafter, the entire body of the three-dimensional shape and the entire surface of the second acrylic fat film 5 are exposed to gamma rays. Then a micro-lens having a desired large curvature is formed by heating the material 6 at an intermediate temperature.



•

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

009092814 **Image available**
WPI Acc No: 1992-220239/199227

XRAM Acc No: C92-099467 XRPX Acc No: N92-167101

Forming micro lens array on pixel array of solid-state colour image sensor - by coating pixel array with transparent resin, patterning resin layer, and heating it to form lens shape NoAbstract

Patent Assignee: MATSUSHITA ELECTRONICS CORP (MATE)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 4074470 A 19920309 JP 90189090 A 19900716 199227 B

Priority Applications (No Type Date): JP 90189090 A 19900716

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 4074470 A 6 H01L-027/14

Title Terms: FORMING; MICRO; LENS; ARRAY; PIXEL; ARRAY; SOLID; STATE; COLOUR; IMAGE; SENSE; COATING; PIXEL; ARRAY; TRANSPARENT; RESIN; PATTERN;

RESIN; LAYER; HEAT; FORM; LENS; SHAPE; NOABSTRACT

Derwent Class: A89; L03; U11; U13; W04

International Patent Class (Main): H01L-027/14

International Patent Class (Additional): H01L-027/148

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): A11-B05; A12-E11A; L04-E05A

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C18D; U13-A01X; W04-M01B5; W04-M01C1;

W04-M01C1A

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-74470

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月9日

H 01 L 27/14 27/148

8122-4M H 01 L 27/14 8122-4M

D B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

3発明の名称 固体撮像装置の製造方法

②特 類 平2-189090

②出 願 平2(1990)7月16日

個発 明 者 木 光 青 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内 @発 明 者 野 佐 和 大阪府門真市大字門真1006番地 籊 松下電子工業株式会社内 ⑫発 明 者 野 鰴 大阪府門真市大字門真1006番地 村 松下電子工業株式会社内 @発 明 者 木 正 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内 ⑦発 明 者 児 玉 達 大阪府門真市大字門真1006番地 宏 松下電子工業株式会社内 頣 大阪府門真市大字門真1006番地 ⑦出 松下電子工業株式会社 人 少代 理 人 弁理士 栗野 重孝 外1名。

明 細 看

1、発明の名称

固体提像装置の製造方法

2、特許請求の範囲

固体機像素子上に、透明樹脂を全面塗布して加熱乾燥することを繰り返す工程と、前記透加熱乾止感光性レジストを全面塗布と低温状態を全面塗布と、前記感光性レジストを選択にある工程と、前記がより、一つを形成する工程と、前記でイクロレンズを高温で加熱処理することを特徴とする固体機像装置の製造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は固体操像素子、特にカラー固体機像索子上に個別の高集光率マイクロレンズを形成する 工程をもつ固体操像装置の製造方法に関するもの である。 従来の技術

近年、固体機像整理は、固体操像素子が有する小型、軽量、長寿命、低残像、低消费電力などの優れた特長のために、ビデオムービーやスチルカメラなどの受光素子として利用されている。

以下、図面を参照しながら従来の固体機像装置の製造方法について説明する。

第2図は従来の固体提像装置のマイクロレンズ 形成工程の一例を示した工程顕断面図である。

第2図(a) において、CCD固体操像素子基板 1 およびフォトダイオード 2 の凹凸表面上に透明樹脂を全面回転燃布したのちに加熱乾燥させて第1 透明平坦膜 7 を形成する。

第2図(b)において、第1週明平坦膜7上に白色 光を分光するための薄膜カラーフィルター4を形 成する。

第2図(C)において、薄膜カラーフィルター4の凹凸表面上に、透明樹脂を全面回転生布したのちに加熱乾燥させて第2透明平坦瞑8を形成する。

特開平4-74470 (2)

型業外線感光性透明樹脂を全面回転塗布したのちに低温乾燥して紫外線感光性透明膜9を形成する。

第2図(e)において、紫外線感光性透明膜 9 に紫外線の選択露光および現像をおこなってマイクロレンズの下地となる所望の立体形状を形成する。

第2図(I)において、紫外線感光性透明膜 9 の立体形状上および第2透明平坦膜 8 上に透明保護膜 1 0 を全面回転塗布したのちに加熱乾燥することによって所望とするマイクロレンズ形状を形成する。

第3回は従来の間体操像装置のマイクロレンズ 形成工程の他の例を示した工程順断面図である。

第3図(a)において、CCD個体操像素子基板1 およびフォトグイオード2の回凸表面上に透明樹脂を全面回転塗布したのちに加熱乾燥させて第1 透明平坦膜7を形成する。

第3図(b) において、第1週明平坦順7上に白色 光を分光するための薄膜カラーフィルター斗を形 成する。

面回転盤布してマイクロレンズ形状を形成しているために、紫外線感光性透明膜 9 の立体形状上に形成したマイクロレンズが十分に大きな曲率をもつことができないといった問題を有していた。

また、第3図図のように、マイクロレンズ材料6の耐溶剤性および耐衝撃性などの信頼性を向するために、200℃以上の高温で熱処りのが無硬化性の方が無変形は無可塑性の方が無硬化性となった。 ゆったマイクロレンズを形成することができず、つまトダイオード2へのレンズ果光平を行に高めることができないといった問題を有していた。

本発明は上記欠点に進み、マイクロレンズ材料 6を中温および高温の2段階に分けて加熱することによって信頼性が高く、しかも十分に大きな曲 中をもったマイクロレンズを形成することかでき、フォトダイオード2へのレンズ集光率を十分 第3図(c)において、薄膜カラーフィルター4の 凹凸表面上に、透明樹脂を全面回転塗布したのち に加熱乾燥させて第2透明平坦聴8を形成する。

第3図(d)において、第2透明平坦暦8上にマイクロレンズ材料6を全面回転盛布したのちに低温で乾燥させる。

第3図側において、マイクロレンズ材料 G に紫外線の選択露光および現像をおこなって所望の立体形状を形成する。

第3図(I)において、マイクロレンス材料6の立体形状上および第2透明平坦膜8上に紫外線の全面産光をおこなって可視光領域の透過率を向上させる。

第3図(8)において、マイクロレンズ材料 6 を 2 0 0 で以上で無処理することによって硬化収縮をおこない、マイクロレンズ形状を形成する。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、上記のような構成では、第2図(I)のように、紫外線感光性透明膜9の立体形状上および第2透明平坦膜8上に透明保護膜10を全

に高めることができる固体撮像装置の製造方法を 提供するものである。

裸題を解決するための手段

作用

この構成によって、信頼性が高く、しかも十分に大きな曲車をもったマイクロレンズを形成することができ、フォトダイオードへのレンズ集光串を十分に高めることができる。

実施例

以下、本発明の一実施側について図面を参照し

特別平4-74470 (3)

ながら説明する。

第 1 図は、本発明の…実施例の固体環像装置の マイクロレンズ形成工程を示した工程順断面図で ある。第1図(a)において、1はCCD固体操作会 子基板である。2は入射光を電気信号に変換する ためのフォトダイオードである。3はCCD固体 提像素子基板1の凹凸を平坦化するための第17 クリル平坦傳である。第1図(5)において、4は人 射光を分光するための薄膜カラーフィルターであ る。第1図(c)において、5は薄膜カラーフィル ター4の凹凸を平坦化するための第2アクリル平 坦腹である。第 1 図 (d) において、 6 はポジ型業外 線感光性レジストで、しかも300mJ/可以上 の紫外線露光によって可視光領域の透過率が全域 にわたって90%以上に向上し、さらに130~ 280℃の加熱処理によって熱可塑性による形状 変化と熱硬化性による形状固定とが同時に進行し て両者の進行差によって形状が決定されるという 性質をもったナフトキノンジアジドを感光甚とす るフェノール系のマイクロシンズ材料である。

級の選択露光を50~500mJ/cdの範囲でお こなったのちに現像をおこなって所望の立体形状 を形成する。

第1図(1)において、マイクロレンズ材料 6 の立体形状上および前記第2アクリル平坦膜 5 上に g 線の全面露光を300m j / d 以上おこなって可視光領域の透過率を全領域で90%以上に向上させる。

第1図図において、マノクロレンズ材料 6 を 1 3 0 ~ 1 8 0 ℃の中温で加熱して熱可塑性と熟硬化性の両性質を制御することによって所望とする十分に大きな曲率をもったマイクロレンズを形成する。

第1図(h)において、マイクロレンズ材料 6 を 1 9 0 ~2 8 0 ℃の高温で熱処理することによって耐溶 剤性および耐熱衝撃性などの信頼性を向上させ る。

以上のように本実施例によれば、第1図回および第1図(h)のように、マイクロレンズ材料 6 の熱処理を130~180℃の中温および190~280

以上のように構成された固体機像装置のマイクロレンズ形成工程について、以下、その動作を説明する。

第1図ははおいて、CCD固体機像素子基板1 およびフォトダイオード2の凹凸装面上にアクリル樹脂を全面回転塗布したのちに加熱乾燥させて 第1アクリル平均膜3を形成する。

第1図(b)において、第1アクリル平坦展3上に 白色光を分光するための薄膜カラーフィルター4 を形成する。

第:図ににおいて、薄膜カラーフィルター4の 凹凸表面上に、アクリル樹脂を全面回転燃布した のちに200~250℃で加熱乾燥する、塗布・ 乾燥工程を2~5回繰り返すことによって平坦性 の高い第2アクリル平坦膜5を形成する。

第1図(d)において、第2ァクリル平坦膜 5 上にマイクロレンズ材料 6 を 0・5 μ m 以上の厚さになるように全面回転塗布したのちに100~120℃で低温乾燥させる。

第1回向において、マイクロレンズ材料6にg

での高温の2段階とすることによって、耐溶剤性および耐熱衝撃性などの信頼性の向上をはかることができ、かつ十分に大きな曲率をもったマイクロレンズを形成できてフォトダイオードへのレンス集光率の向上をはかることができる。

特閒平4-74470 (4)

形状固定とが同時に進行して両者の進行差によって形状が決定され、耐溶剤性などの信頼性が自好であるといった性質をもった感光性レジストであればよい。

発明の効果

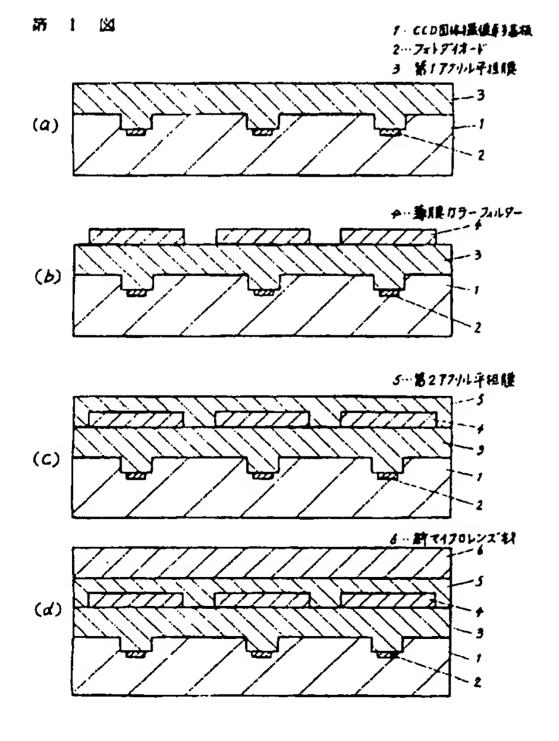
以上のように本発明によれば、ナフトキノンシャンドを感光基とするフェノール系のマイクロレンズ材料の無処理を130~180℃の中温および190~280℃の高温の2段階とすることによって、耐溶剤性および耐熱衝撃性などの信頼性の向上とマイクロレンズ集光率の向上をはかることができ、その実用的効果は大なるものがある。

4、図面の簡単な説明

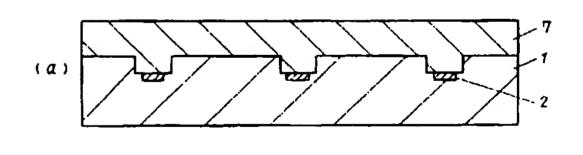
第1図は本発明の一実施例の固体撮像装置のマイクロレンズ形成工程順断面図、第2図および第3図は従来各例の固体機像装置のマイクロレンズ形成工程順断面図である。

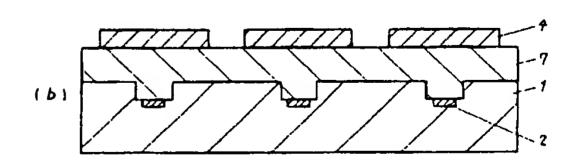
1 ··· ··· C C D 固体機像素子基板、 2 ··· ·· フェト ダイオード、 3 ··· ·· 第 1 アクリル平坦膜、 4 ··· ·· 薄膜カラーフィルター、5 ……第2 アクリル半坦膜、6 ……マイクロレンズ材料、7 ……第1 邀明平坦膜、8 ……第2 透明平坦膜、9 ……紫外線感光性透明膜、10 ……透明保護膜。

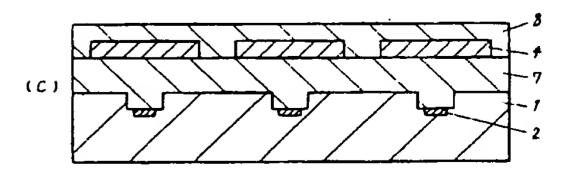
代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか1名



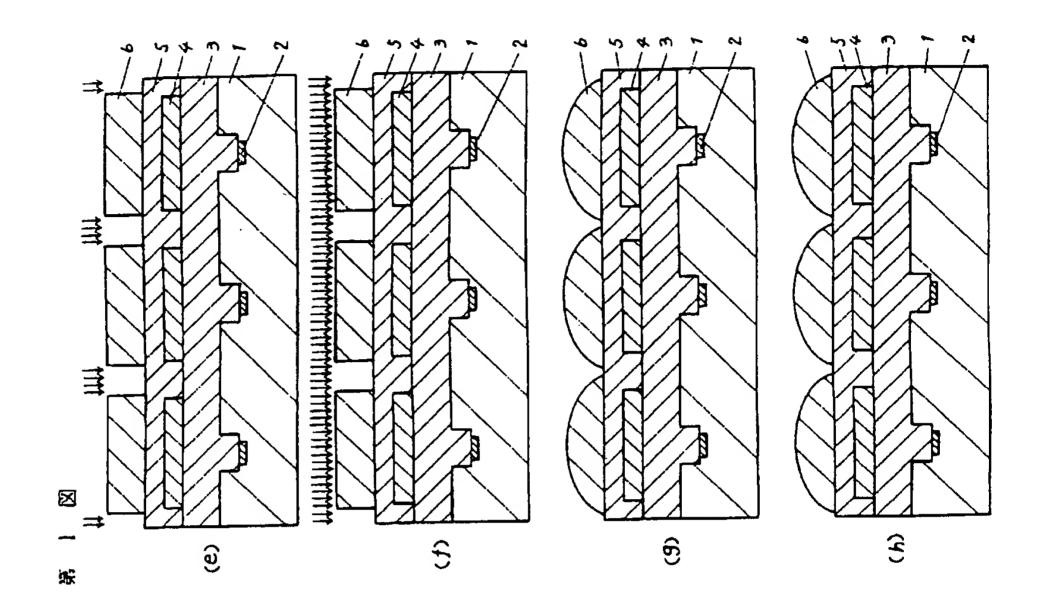
第 2 図







持開平4-74470 (5)



2 [3]

3 [3]

(a)

(b)

(c)

(i)

(d)

(i)

(d)

(i)

特開平4-74470 (6)

新 3 図

